

## ■ Rietveld 法の原理

Step Sampling された XRD Pattern において,  $i$  番めの回折強度  $y_i(o)$  に対する計算値  $f_i(c)$  は

$$f_i(c) = y_{iB}(c) + y_{ib}(c) \quad (1)$$

で表される. ここで  $y_{iB}(c)$  は Bragg 反射強度を,  $y_{ib}(c)$  はバックグラウンド強度を表す.  $y_{iB}(c)$  はさらに

$$y_{iB}(c) = \sum_k S_k |F_k|^2 m_k P_k L(\theta_k) G(\theta_i, \theta_k) \quad (2)$$

で表される. (2) において  $k$  は相の番号,  $S_k$  はスケールファクター,  $F_k$  は構造因子,  $m_k$  は多重度,  $P_k$  は選択配向関数,  $\theta_k$  は Bragg 反射角度,  $L(\theta_k)$  は Lorentz 因子, そして  $G(\theta_i, \theta_k)$  はプロファイル関数を表す.

選択配向関数  $P_k$  は試料が針状あるいは強いへき開を示す場合に XRD Pattern に現れる特殊な傾向を補正するために用いる関数である. RIETAN では,

$$P_k = P_1 + (1 - P_1) \exp(-P_2 \varphi_k^2), \quad (3)$$

$$P'_k = \exp\left[P_2 \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_k\right)^2\right] \quad (4)$$

のどちらかを使う. ここで  $\varphi_k$  は

$$\varphi_k = \begin{cases} \phi_k, & \text{へき開面を持つ場合,} \\ \frac{\pi}{2} - \phi_k, & \text{針状の場合} \end{cases}$$

である.

ここで (3),(4) 式における  $\phi_k$  を求めるために選択配向ベクトル  $\mathbf{P}^* = h_p \mathbf{a}^* + k_p \mathbf{b}^* + l_p \mathbf{c}^*$  を導入する.  $\mathbf{P}^*$  は針状結晶の伸長方向に平行で, へき開面の法線方向に平行と定める. この  $\mathbf{P}^*$  と逆格子ベクトル  $\mathbf{b}^* = h \mathbf{a}^* + k \mathbf{b}^* + l \mathbf{c}^*$  の成す鋭角が  $\phi_k$  である.

XRD Pattern におけるプロファイル関数  $G(\theta_i, \theta_k)$  は,

$$G(\theta_i, \theta_k) = a(\theta_i, \theta_k) \cdot g(\theta_i, \theta_k) \quad (5)$$

と表される. (5) で  $a(\theta_i, \theta_k)$  は低  $2\theta$  領域における Bragg 反射角度  $\theta_i$  のシフトとピークシェイプの非対称性を表す関数,  $g(\theta_i, \theta_k)$  は対称プロファイル関数である.

$a(\theta_i, \theta_k)$  は,

$$a(\theta_i, \theta_k) = \frac{Q \sin(\Delta\theta_{ik})(2\Delta\theta_{ik})^2}{\tan \theta_k} \quad (6)$$

で表される. ここで  $Q$  はピークシェイプの非対称性を表すパラメーターであり,  $\Delta\theta_{ik} = |\theta_i - \theta_k|$  である.

$g(\theta_i, \theta_k)$  は,

$$g(\theta_i, \theta_k) = A \left\{ \gamma \exp\left[-\frac{C_0(2\Delta\theta_{ik})^2}{H_G(\theta_k)^2}\right] + (1 - \gamma) \left[1 + \frac{C_1(2\Delta\theta_{ik})^2}{H_L(\theta_k)^2}\right]^{-1} \right\} \quad (7)$$

で表される. (7) で  $A$  は規格化因子,  $x = 2\theta_i - 2\theta_k$ ,  $A \exp(-Cx^2/H_G(\theta_k)^2)$  は  $H_G(\theta_k)$  を半値幅とする Gauss 関数,  $A(1 + Cx^2/H_L(\theta_k)^2)$  は  $H_L(\theta_k)$  を半値幅とする Lorentz 関数,  $\gamma$  はピークに対する Gauss 関数成分の割合を表す.

(7) 式における  $H_G(\theta_k)$  は

$$H_G(\theta_k) = [U(\tan \theta_k - q)^2 + V(\tan \theta_k - q) + W]^{\frac{1}{2}} \quad (8)$$

で与えられる. (8) 式のなかでは  $q = 0$  または  $q = 0.5$  である.  $H_L(\theta_k)$  は回折角度とともに変化し,

$$H_L(\theta_k) = (X + X_e \cos \varphi_k) \sec \theta_k + (Y + Y_e \cos \varphi_k) \tan \theta_k \quad (8')$$

で与えられる.

バックグラウンド関数  $y_{ib}(c)$  は

$$y_{ib}(c) = \sum_{j=0}^5 b_j \left[ \frac{2\theta_i - \theta_{max} - \theta_{min}}{\theta_{max} - \theta_{min}} \right]^j \quad (9)$$

で与えられる.  $\theta_{max}$ ,  $\theta_{min}$  は回折角度の最大値と最小値を表す.  $\theta$  は Bragg 反射角度である.